

	L #	Hits	Search Text	DBs
1	L16	132479	silicon with (nitride or oxynitride)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
2	L17	386613	mask or photomask or reticle	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
3	L18	410123	etch or etching or etched	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
4	L19	910760	reflect reflection reflective reflecting reflected	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
5	L20	386613	mask or photomask or reticle	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
6	L21	9193	hard adj L20	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
7	L22	1580	hardmask	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
8	L23	1580	hardmask	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
9	L24	9193	hard adj L20	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
10	L25	10148	L23 L24	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
11	L26	2619	L25.clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
12	L27	132479	silicon with (nitride or oxynitride)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
13	L28	910760	reflect reflection reflective reflecting reflected	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
14	L29	18903	L20 with L28	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
15	L30	294	L27 with L29	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
16	L31	127	L30 L25	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
17	L32	69049	L20.clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
18	L33	93	L31 L32	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
19	L34	2619	L25.clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
20	L35	52	L33 L34	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
21	L36	34	L30.clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO

	<b>L #</b>	<b>Hits</b>	<b>Search Text</b>	<b>DBs</b>
<b>22</b>	L37	14	L35 L36	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
<b>23</b>	L38	7505	430/5.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
<b>24</b>	L39	1944	28 38	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
<b>25</b>	L40	157192	19.clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
<b>26</b>	L41	497	40 39	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
<b>27</b>	L42	20	41 26	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO